

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成20年6月19日(2008.6.19)

【公開番号】特開2003-82129(P2003-82129A)

【公開日】平成15年3月19日(2003.3.19)

【出願番号】特願2001-281181(P2001-281181)

【國際特許分類】

C	0	8	J	5/22	(2006.01)
C	0	8	F	259/08	(2006.01)
H	0	1	B	1/06	(2006.01)
H	0	1	B	1/12	(2006.01)
C	2	5	B	13/08	(2006.01)
H	0	1	M	8/02	(2006.01)
H	0	1	M	8/10	(2006.01)
C	0	8	L	27/18	(2006.01)

〔 F I 〕

C	0	8	J	5/22	1	0	1
C	0	8	J	5/22	C	E	W
C	0	8	F	259/08			
H	0	1	B	1/06			A
H	0	1	B	1/12			Z
C	2	5	B	13/08	3	0	1
H	0	1	M	8/02			P
H	0	1	M	8/10			
C	0	8	L	27:18			

【手續補正書】

【提出日】平成20年5月2日(2008.5.2)

【手續補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0011

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 1 1 】

【化 2】

$$\begin{aligned}
 &= ((CF_2)_n - \underbrace{CF - (CF_2)_m}_{(CF_2)_k})_r - && (PTFE \text{主鎖}) \\
 &= ((CF_2)_n - \underbrace{CF - (CF_2)_d}_{(CF_2)_d})_r - && (長鎖分歧) \\
 &= ((CF_2)_n - \underbrace{CF - (CF_2)_d}_{(CF_2)_d})_r - && (PTFE \text{主鎖})
 \end{aligned}$$

式中の n , m , r , k は 1 以上の任意の整数変数。また、 $c \approx n$, $d \approx m$, $r \approx f$ である。また、化 1 と化 2 について、長鎖分歧末端部と PTFE 主鎖部の結合がエーテル結合、
 $(-O-)$ となっているもの、および、長鎖分歧部と PTFE 主鎖部に照射によって
生成した二重結合 $[-CF=CF-]$ を有するものを含む。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

本発明によるフッ素系高分子イオン交換膜は、上記の長鎖分岐型PTEFE構造を主体とし、これにフルオロエチレン単位が共グラフトして共グラフト鎖を形成し、スルホン酸基[-SO₃H]とカルボキシル基[-COOH]が[-(CF₂)-]単位を挟んでグラフト鎖の炭素に直接結合したフッ素系高分子から成る。スルホン酸基とカルボキシル基は[-(CF₂)-]単位を挟んで炭素に結合していてもよいが、例えば、スルホン酸基が2~5個続いて結合して、カルボン酸が1個結合していてもよい。この割合は、下記に述べる製造方法において、重合性モノマーである，，，-トリフルオロエチレンスルホニルハライドとアルキル-，，，-トリフルオロアクリレートのグラフト反応時におけるモノマーの仕込み比によって決まる。